Docket No.: 43890-622

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Hideki KUWAJIMA, et al.

Serial No.:

Group Art Unit:

Filed: July 29, 2003

Examiner:

For:

PIEZOELECTRIC ACTUATOR, DISK DRIVE USING THE SAME AND MANUFACTURING

METHOD THEREOF

CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop CPD Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. 2002-219346, filed July 29, 2002

cited in the Declaration of the present application. A certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MODERMOTT, WILL & EMERY

Michael E Fogarty

Registration No. 36,139

600 13th Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 MEF:mcw Facsimile: (202) 756-8087

Date: July 29, 2003

日本国特許 JAPAN PATENT OFFICE

43890-622 KUWAJIMA etal. July 29, 2003

McDermott, Will & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月29日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-219346

[ST.10/C]:

[JP2002-219346]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年 4月18日

許庁長官 ommissioner, upan Patent Office 人名は一端門

【書類名】

特許願

【整理番号】

2037240031

【提出日】

平成14年 7月29日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G11B 21/21

G11B 5/31

G11B 33/12

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

桑島 秀樹

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

松岡 薫

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

内山 博一

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【氏名又は名称】

松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】

岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

ソ

【発明の名称】 圧電アクチュエータ、圧電アクチュエータを用いたディスク装置、および圧電アクチュエータの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ディスク装置におけるヘッド位置決め機構に用いる圧電アクチュエータが、

第1の圧電体素子ユニットと、

前記第1の圧電体素子ユニットと略平行に配置された第2の圧電体素子ユニットと、

前記第1の圧電体素子ユニットと前記第2の圧電体素子ユニットとを連結する 連結部とを有することを特徴とする圧電アクチュエータ。

【請求項2】 前記連結部は、前記第1の圧電体素子ユニットおよび前記第2 の圧電体素子ユニットを被覆保護する保護膜で形成されていることを特徴とする 請求項1に記載の圧電アクチュエータ。

【請求項3】 前記保護膜が樹脂で形成されていることを特徴とする請求項2 に記載の圧電アクチュエータ。

【請求項4】 前記連結部にスリットが形成されていることを特徴とする請求 項1に記載の圧電アクチュエータ。

【請求項5】 前記連結部は、前記第1の圧電体素子ユニットと前記第2の圧電体素子ユニットそれぞれの少なくとも先端付近と、前記スリットを挟んで前記 先端付近の反対側部分とで連結されていることを特徴とする請求項4に記載の圧電アクチュエータ。

【請求項6】 前記第1の圧電体素子ユニットおよび前記第2の圧電体素子ユニットが薄膜で形成されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の圧電アクチュエータ。

【請求項7】 前記第1の圧電体素子ユニットおよび前記第2の圧電体素子ユニットは、薄膜圧電体の上下の表面に金属膜を成膜して被覆形成した薄膜圧電体形成体を2個用い、2個の前記薄膜圧電体形成体を接着剤からなる接着層を挟んで積層形成したことを特徴とする請求項6に記載の圧電アクチュエータ。

【請求項8】 ヘッド位置決め機構に用いる圧電アクチュエータを備えるディスク装置において、

第1の圧電体素子ユニットと、

前記第1の圧電体素子ユニットと略並行に位置する第2の圧電体素子ユニットと、

前記第1の圧電体素子ユニットと前記第2の圧電体素子ユニットとを連結する 連結部とを有する圧電アクチュエータを備えることを特徴とするディスク装置。

【請求項9】 前記連結部にスリットが形成され、

前記連結部が、前記第1の圧電体素子ユニットと前記第2の圧電体素子ユニットそれぞれの少なくとも先端付近と、前記スリットを挟んで前記先端付近の反対側部分とで連結されている圧電アクチュエータを備えることを特徴とする請求項8に記載のディスク装置。

【請求項10】 第1基板上に第1電極金属膜、第1薄膜圧電体および第2電極金属膜を順次成膜する工程と、

第2基板上に第3電極金属膜、第2薄膜圧電体および第4電極金属膜を順次成 膜する工程と、

前記第2電極金属膜と前記第3電極金属膜とを接着する工程と、

前記第1基板を除去する工程と、

2層構造の前記第1薄膜圧電体および前記第2薄膜圧電体をドライエッチング して所定の形状に成形加工する工程と、

ドライエッチング加工した前記第1薄膜圧電体および前記第2薄膜圧電体をコーティング樹脂で覆う工程と、

覆った前記コーティング樹脂に所定の形状のスリット部をパターンニングする 工程と、

前記第2基板を除去する工程とを有することを特徴とする圧電アクチュエータの製造方法。

【請求項11】 前記第1基板および前記第2基板が単結晶で形成されている ことを特徴とする請求項10記載の圧電アクチュエータの製造方法。

【請求項12】 前記コーティング樹脂をパターンニングする工程は、

前記スリット部と、

前記第1薄膜圧電体と前記第2薄膜圧電体それぞれの少なくとも先端付近と前 記スリットを挟んで前記先端付近の反対側部分とにおいて連結されている連結部 とを形成する工程を含むことを特徴とする請求項10または請求項11に記載の 圧電アクチュエータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電圧を印加すると伸縮する特性を備えた圧電材料により形成したアクチュエータ素子に関し、特にディスク装置におけるヘッド位置決め機構に用いられるアクチュータ素子、圧電アクチュエータを用いたディスク装置、および圧電アクチュエータの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

ディスク装置は、近年、ヘッド素子の改善によりトラックに沿った線記録密度が向上している。これに伴いトラックに垂直方向の記録密度の向上が重要になり、より微細なトラックピッチを実現することが求められてきている。幅の狭いトラックに正確にヘッドを追従させるためには、ヘッドを微小に移動させる機構が必要であると考えられている。

[0003]

以下、ディスク装置のなかでも記録密度が向上するとともに容量が増大し、パーソナルコンピュータ(PC)以外の分野にも用途が拡大してきている磁気ディスク装置について説明する。図21は、一般的な構成の磁気ディスク装置において通常よく用いられるヘッド支持機構200の構成の一例を示す平面図である。図21において、回転駆動される磁気ディスク150に対するデータの記録/再生を行うヘッドを搭載したスライダ102は、支持アーム(サスペンションアームとも記す)104の一端に支持されている。支持アーム104の他方の端部は、キャリッジ106の突起108を中心に微小角範囲内で回動可能に支持されている。キャリッジ106は、磁気ディスク装置のハウジング(図示せず)に固定

された軸部材110に、回動可能に支持されている。

[0004]

磁気回路112の一部である駆動コイル114がハウジング側に固定されて設けられており、この駆動コイル114に励磁電流を流すことによって、キャリッジ106に取り付けられた永久磁石(図示せず)との間に作用する磁力によってキャリッジ106が回動する。駆動コイル114に供給する励磁電流を制御することによってキャリッジ106がそれに応じた角度だけ回動し、ヘッドを搭載したスライダ102を磁気ディスク150の実質的な半径方向へ希望する位置まで移動する。

[0005]

キャリッジ106と支持アーム104との間には、一対の圧電素子116が設けられている。各圧電素子116は、図21に示すようにキャリッジ106の長手方向に対して、それぞれの長手方向が若干の角度をもって対象的な位置関係となるように取り付けられている。そして、各圧電素子116をそれぞれ図21に矢印A14で示す方向に伸縮させることによって、支持アーム104の先端部に取り付けられたスライダ102を、磁気ディスク150の表面に沿って、微小な範囲で変位させ、磁気ディスク150上の希望するところに高い精度で位置決めすることができる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

上述のヘッド支持機構200では、各圧電素子116が、支持アーム104およびキャリッジ106にそれぞれ設けられた部材の間にそれぞれ挟まれた状態に保持されているので、各圧電素子116の側部が、支持アーム104とキャリッジ106の各部材に当接している。そして、各圧電素子116の伸縮によって、支持アーム104を回動させてヘッド102を微小に変位させるようになっている。

[0007]

しかしながら、図21に示すような一般的なヘッド支持機構では、各圧電素子 を別々にキャリッジに取り付ける構成となっており、アクチュエータの組立工数 がかかるとともに、アクチュエータ取り付けの際、圧電アクチュエータを破損するおそれがあった。

[0008]

本発明は上記のような、アクチュエータ取り付け時の破損のおそれを解消し、 組立性に優れ、かつ効率的にヘッドを微小変位させることが可能な圧電アクチュ エータと、その製造方法およびこれを用いたヘッド支持機構を備えるディスク装 置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

この目的を達成するために本発明の圧電アクチュエータは、具体的には、ディ スク装置におけるヘッド位置決め機構に用いる圧電アクチュエータが、第1の圧 電体素子ユニットと、第1の圧電体素子ユニットと略平行に配置された第2の圧 電体素子ユニットと、第1の圧電体素子ユニットと第2の体素子ユニットとを連 結する連結部とを有する構成を備えている。さらに、本発明の圧電アクチュエー タは、連結部にスリットが形成されている構成、連結部が第1の圧電体素子ユニ ットと第2の圧電体素子ユニットそれぞれの少なくとも先端付近と、スリットを 挟んで先端付近の反対側部分とで連結されている構成、連結部が第1の圧電体素 子ユニットおよび第2の圧電体素子ユニットを被覆保護する保護膜で形成されて いる構成、保護膜が樹脂で形成されている構成、第1の圧電体素子ユニットおよ び第2の圧電体素子ユニットが薄膜で形成されている構成、さらには第1の圧電 体素子ユニットおよび第2の圧電体素子ユニットが薄膜圧電体の上下の表面に金 属膜を成膜して被覆形成した薄膜圧電体形成体を2個用い、2個の薄膜圧電体形 成体を接着剤からなる接着層を挟んで積層形成した構成をも備えている。これら の構成により、各圧電アクチュエータを一体でサスペンションに取り付けること ができ、互いに一体となりつつも各圧電アクチュエータの変位を阻害しにくく、 各圧電アクチュエータを最小限の連結部で確実に一体化することが可能で、圧電 材料とは異なる柔らかい材料で各圧電アクチュエータを一体化し、より変位特性 を阻害しにくくすることができるものである。

[0010]

5

また、本発明のディスク装置は、ヘッド位置決め機構に用いる圧電アクチュエータを備えるディスク装置において、第1の圧電体素子ユニットと、第1の圧電体素子ユニットと略並行に位置する第2の圧電体素子ユニットと、第1の圧電体素子ユニットと第2の体素子ユニットとを連結する連結部とを有する圧電アクチュエータを備える構成を有している。さらに、本発明のディスク装置は、連結部にスリットが形成され、連結部は第1の圧電体素子ユニットと第2の圧電体素子ユニットをれぞれの少なくとも先端付近とスリットを挟んで先端付近の反対部分とで連結されている圧電アクチュエータを備える構成をも有している。これらの構成により、各圧電体素子ユニットを最小限の連結部で確実に一体化してサスペンションに取り付けることができ、互いに一体となりつつも各圧電体素子ユニットの変位特性を阻害しにくくした圧電アクチュエータを備える優れたディスク装置を実現できる。

[0011]

また、本発明の圧電アクチュエータの製造方法は、第1基板上に第1電極金属 膜、第1薄膜圧電体および第2電極金属膜を順次成膜する工程と、第2基板上に 第3電極金属膜、第2薄膜圧電体および第4電極金属膜を順次成膜する工程と、 第2電極金属膜と第3電極金属膜とを接着する工程と、第1基板を除去する工程 と、2層構造の第1薄膜圧電および第2薄膜圧電体をドライエッチングして所定 の形状に成形加工する工程と、ドライエッチング加工した第1薄膜圧電体および 第2薄膜圧電体をコーティング樹脂で覆う工程と、覆ったコーティング樹脂に所 定の形状のスリット部をパターンニングする工程と第2基板を除去する工程とを 備えた構成と、第1基板および第2基板が単結晶で形成されている構成を有して いる。さらに、本発明の圧電アクチュエータの製造方法は、コーティング樹脂を パターンニングする工程が、スリット部と、第1薄膜圧電体と第2薄膜圧電体そ れぞれの少なくとも先端付近とスリットを挟んで先端付近の反対側部分とにおい て連結されている連結部とを形成する工程を含む構成をも有している。これらの 構成により、各圧電体素子ユニットを最小限の連結部で確実に一体化してサスペ ンションに取り付けるとともに、互いに一体となりつつも各圧電体素子ユニット の変位特性を阻害しにくくした圧電アクチュエータを形成できるので、組立性に

優れ、不良品の発生が少ない製造方法を提供することができるものである。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下、本発明における圧電アクチュエータおよびこれを備えるヘッド支持機構 の構成、また、圧電アクチュエータの製造、加工方法、そして製造、加工冶具に ついて図面を参照しながら詳しく説明する。

[0013]

図1は本発明の実施の形態における圧電アクチュエータを備えたヘッド支持機構の斜視図であり、図2はそのヘッド支持機構を分解して示す斜視図である。また、図3はそのヘッド支持機構におけるスライダの斜視図である。

[0014]

図1から図3において、ヘッド支持機構100は、ヘッド素子としての例えば磁気ヘッド1が取り付けられたスライダ2を先端部に支持するロードビーム4を有している。ロードビーム4は、ヘッドアクチュエータアーム(図示せず)に取り付けられる正方形状をした基端部4aを有し、基端部4aは、ビーム溶接等によってベースプレート5に固定されている。ベースプレート5は、上記ヘッドアクチュエータアームに取り付けられている。ロードビーム4には、基端部4aから先細状に続くネック部4bに延出し、さらにそれに連続して、ビーム部4cが直線状に延出するように設けられている。ネック部4bの中央部は、開口部4dが設けられて、板バネ部4eを構成している。ビーム部4cの先端部における各側縁部には、スライダ保持基板3aの回動を若干の隙間をもって規制する規制部4fがそれぞれ設けられている。

[0015]

なお各規制部4 f は、ビーム部4 c の先端から基端部4 a 側に向かって直線状に延出している。ビーム部4 c 上には、ヘッド配線パターン6を有するフレクシャ7が設けられている。フレクシャ7は、ステンレススチール材をベースとしている。フレクシャ7の一端に設けられたスライダ取付部7×上には、磁気ヘッド1が搭載されたスライダ2が配置されている。

[0016]

スライダ2の磁気ヘッド1が設けられた端面の下部には、4つの端子2a~2dが並設されている(図3参照)。さらに、スライダ2の上面には、回転駆動される磁気ディスク(図示せず)によって生じる空気流が、スライダ2のピッチ方向(磁気ディスクの接線方向)に沿って通流させて、磁気ディスクとの間にエア潤滑膜を形成するエアベアリング面2eが設けられている。エアベアリング面2eの中心位置は、ロードビーム4のディンプル4gに一致している。

[0017]

図4はヘッド支持機構100におけるフレクシャ7の先端部分の構成を示す分 解状態の斜視図である。図4において、フレクシャ7は、フレクシャ7の本体を 構成するフレクシャ基板3と、フレクシャ7の一端に設けられたスライダ保持基 板3aとを有している。フレクシャ基板3とスライダ保持基板3aとは、例えば 、ステンレス等からなっており、フレクシャ基板3の一端(フレクシャ7の一端)にスライダ保持基板3aは同一平面に配置されている。フレクシャ基板3とス ライダ保持基板3aとの間には、両者の表面に、例えばポリイミド樹脂等からな るフレキシブル基板Fが設けられており、このフレキシブル基板Fによりフレク シャ基板3とスライダ保持基板3aとは機械的に連結されている。さらには、フ レキシブル基板Fには局部的に狭い幅で形成された弾性ヒンジ部となる繋ぎ部1 9a,19bが設けられている。繋ぎ部19a,19bは、フレクシャ基板3と スライダ保持基板3 a との間の境目に設けられており、両基板は、繋ぎ部19 a ,19bにより互いに可動自在に連結されている。フレキシブル基板Fの上面に は配線6a,6b,6c,6dが設けられている。また、フレキシブル基板Fの 上面には、薄膜保持部8a,8bが互いに並列した状態で設けられている。薄膜 保持部8a,8bは、フレクシャ基板3の一端側に設けられている。薄膜保持部 8a,8bは、後述する圧電アクチュエータ素子10を載置可能な面状に形成さ れている。なお、スライダ保持基板3aの外形形状は、フレクシャ基板3と同時 にエッチング加工により形成される。

[0018]

スライダ保持基板3 a には突起部3 b が形成され、この突起部3 b はロードビーム4 の先端付近に形成されたディンプル4 g に当接している。この突起部3 b

がディンプル4gによって押圧されることにより、ディンプル4gを中心として 全方位にわたってスライダ保持基板3aは回動可能に保持されている。

[0019]

フレクシャ7の他方の端部には、外部接続端子保持部7yが設けられている。 外部接続端子保持部7yは、ロードビーム4の基端部4aにおける一方の側縁部 に配置されている。

[0020]

次に、本発明の実施の形態における薄膜で形成した圧電アクチュエータ素子1 0について説明する。図5はヘッド支持機構100におけるロードビーム4のス ライダ2を配置するもう一方の先端側にある薄膜保持部8a,8bに載置される 圧電アクチュエータ素子10を平面図で示している。薄膜製の圧電アクチュエー タ素子10は、ともに薄膜圧電体で形成された第1の圧電体素子ユニット10a と第2の圧電体素子ユニット10bとからなり、圧電アクチュエータ素子10の 全体は、柔軟性のあるコーティング樹脂 1 4 でカバーされている。これら薄膜圧 電体で形成された第1の圧電体素子ユニット10aと第2の圧電体素子ユニット 10bとはコーティング樹脂14の一部である第1の連結部14aと先端付近の 第2の連結部14bの2箇所で繋がっており、第1の圧電体素子ユニット10a および第2の圧電体素子ユニット10bの間にスリット10cが形成されている 。図6は図5中のZ-Z)線における断面図である。図5および図6において、 圧電アクチュエータ素子10は、フレクシャ7の薄膜保持部8a, 8b (図4参 照)に接着して取り付けられる。スリット10cは第1の圧電体素子ユニット1 O a および第2の圧電体素子ユニット10bの間に形成されている。なお、薄膜 保持部8a,8bにおいては、圧電アクチュエータ素子10を接着する面に、接 着性を向上させるため、例えばクローム等の材料によりサブミクロンオーダーの 薄膜がコーティングされている。

[0021]

また、図6の断面図が示すように、圧電アクチュエータ素子10は、左右それ ぞれ別々の第1の圧電体素子ユニット10aおよび第2の圧電体素子ユニット1 0bが一対となって構成されている。第1の圧電体素子ユニット10aおよび第 2の圧電体素子ユニット10bは、第1の薄膜圧電体11aおよび第2の薄膜圧電体11bとが積層配置された2層構造を有している。図から見て上部に位置する第1の薄膜圧電体11aの上側および下側には、第1の電極金属膜12aと第2の電極金属膜12bが形成されている。同様に第2の薄膜圧電体11bは、第1の薄膜圧電体11aの下部に配置され、その両面には第3の電極金属膜12cと第4の電極金属膜12dとが設けられている。第2の電極金属膜12bと第3の電極金属膜12cとは接着剤13で接着されている。

[0022]

図7は本発明の実施の形態における圧電アクチュエータ素子10を備えるヘッド支持機構100のフレクシャ7周辺を平面図で示している。即ち、この図7は圧電アクチュエータ素子10を貼り付けたフレクシャ7をスライダ2を貼り付ける側から見た平面図で示している(スライダ2は図示せず)。図8は図7に示すX-X'線による断面図(圧電アクチュエータ素子10を貼りつけた状態)である。図9は図7に示すY-Y'線による断面図ある。図7から図9に示すように、圧電アクチュエータ素子10の周囲には配線6a,6b,6c,6dおよびスライダ2(図示せず)のグランド配線9dが圧電アクチュエータ素子10と同一平面上に配置されている。

[0023]

次に本発明の実施の形態における圧電アクチュエータ素子10の配線について説明する。図9において、圧電アクチュエータ素子10の第1の電極金属膜12。a,第4の電極金属膜12dにはプラス電圧が加えられ、第2の電極金属膜12b,第3の電極金属膜12cはグランド電位に落とされている。第1の電極金属膜12a,第4の電極金属膜12dは、フレクシャ7の中程に配置された薄膜圧電体素子駆動配線9a,9bに対してワイヤボンド線16で接続されている。第2の電極金属膜12bと第3の電極金属膜12cとは、グランド金属膜17を介して薄膜圧電体素子駆動配線9cに接続されている。スライダ2のグランド配線9dは、スライダ2のアース端子であり、薄膜圧電体素子駆動配線9cに短絡されている。これら薄膜圧電体素子駆動配線9a,9b,9cは外部接続端子保持部7yに一方の端部が設けられており、外部の駆動回路(図示せず)に接続され

ている。

[0024]

続いて圧電アクチュエータ素子10を形成する手順を簡単に説明する。図10に圧電アクチュエータ素子10およびその第1の電極金属膜12a~第4の電極金属膜12dを単結晶MgO基板18上で成膜する手順を圧電アクチュエータ素子10の拡大断面図で示す。まず、図10(a)に示すように単結晶MgO基板18上に第1の電極金属膜12d)を成膜する。次に、図10(b)に示すように第1の電極金属膜12d)を成膜する。次に、図10(b)に示すように第1の電極金属膜12a(第4の電極金属膜12d)の上にPZT(ジルコン酸チタン酸鉛、Pb(Zr_xTi_{1-x})O₃)等の第1の薄膜圧電体11a(第2の薄膜圧電体11b)をスパッタ蒸着法やMBE法等で単結晶成長させる。さらに、図10(c)に示すように第1の薄膜圧電体11a(第2の薄膜圧電体11b)の上面に第2の電極金属膜12b(第3の電極金属膜12c)を成膜する。第1の薄膜圧電体11a(第2の薄膜圧電体11b)の分極方向は成膜時点で、図10(c)中に矢印Pで示したように、分極方向は結晶のc軸方向に向いている。

[0025]

図11は単結晶Mg〇基板18上に成膜した第1の薄膜圧電体11a(第2の薄膜圧電体11b)を2層講造化する手順を示した図であり、図12は第1の薄膜圧電体11a(第2の薄膜圧電体11b)の製造方法を工程の各ステップごとに示すフローチャートである。図11および図12の各ステップを参照して第1の薄膜圧電体11a(第2の薄膜圧電体11b)を2層構成にする工程の手順を説明する。

[0026]

図11(a)に示すように第1の単結晶MgO基板18a上に第1の電極金属膜12a、第1の薄膜圧電体11aおよび第2の電極金属膜12bを形成する(図12のステップS1201)。図11(a)は、図10と異なり、単結晶MgO基板18を上方に配置して示している。次に、図11(b)に示すように第2の単結晶MgO基板18b上に第3の電極金属膜12c、第2の薄膜圧電体11bおよび第4の電極金属膜12dを形成する(図12のステップS1202)。

[0027]

その後、図11(c)に示すように、第2の電極金属膜12bと第3の電極金属膜12cを接着剤13で接着する(図12のステップS1203)。

[0028]

次に、図11(d)に示すように、単結晶MgO基板18のうちの一方である第1の単結晶MgO基板18aをエッチングで除去する(図12のステップS1204)。その後、図11(e)に示すように、2層構造の第1の薄膜圧電体11a,第2の薄膜圧電体11bを圧電アクチュエータ素子10の形状になるようにドライエッチングで成形加工する(図12のステップS1205)。

[0029]

次に、図11(f)に示すように、圧電アクチュエータ素子10の腐食を回避するために、第2の単結晶MgO基板18b上において、圧電アクチュエータ素子10が形成された表面をコーティング樹脂14で覆う(図12のステップS1206、図5も参照)。このとき、コーティングはスピンコートで行った後パターンニング加工を行い第1の連結部14a,第2の連結部14bを形成する(図5参照)。その後、図11(g)に示すように、最後に残っていた第2の単結晶MgO基板18bをエッチング除去することにより圧電アクチュエータ素子10を得る(図12のステップS1207、図5も参照)。

[0030]

なお、第1の電極金属膜12aと第4の電極金属膜12dとの接着は樹脂製接着剤を用いずに金属電極同士を溶着して接合してもよい。

[0031]

引き続き、第2の単結晶Mg〇基板18b上に形成した圧電アクチュエータ素子10を薄膜として取り出す方法について説明する。図13は第2の単結晶Mg〇基板18bを除去する手順を工程的に示した図である。圧電アクチュエータ素子10は、図13(a)に示すように1枚の第2の単結晶Mg〇基板18b上に複数形成されているので、図13(b)に示すように、第2の単結晶Mg〇基板18bを網籠202に載せて、第2の単結晶Mg〇基板18bを溶解して除去することができる溶液を満たした溶解槽201に浸される。これによって圧電アク

チュエータ素子10は、膜の状態で取り出される。この溶解槽201の溶解液は強制的に循環されており第2の単結晶MgO基板18bは、完全に溶解される(図12のステップS1207)。そして完全に溶解が完了した時点で溶解槽201上部に設けられた開閉扉203が開放される。これにより圧電アクチュエータ素子10は溶解液を洗浄する流路204に沿って移送される。このとき第1の圧電体素子ユニット10aと第2の圧電体素子ユニット10bは、第1の連結部14aと先端付近の第2の連結部14bの2箇所で結合されているので(図5参照)、圧電アクチュエータ素子10の破損を回避している。

[0032]

この流路204には、図13(c)に示すように圧電アクチュエータ素子10を攪拌する超音波振動器205が備えられており、圧電アクチュエータ素子10は超音波振動を加えられながら流路204に沿って搬送される。流路204の下流にはベルトコンベア206が設けられ、圧電アクチュエータ素子10を流路204から取り出し乾燥される。乾燥した圧電アクチュエータ素子10は、エアピンセット(図示せず)で吸引し搬送され、図13(d)に示すようにトレイ207に並べられる(図12のステップS1208)。

[0033]

圧電アクチュエータ素子10を、薄膜保持部8a,8bに高精度に貼り付ける方法について図12、および図14から図17を参照して説明する。図14は圧電アクチュエータ素子10を第1の位置決めベース209上に位置決めする工程の手順を説明するための図であり、図15は第1の位置決めベース209の斜視図である。図16は第2の位置決めベース211の斜視図であり、図17は第2の位置決めベース211を第1の位置決めベース209に重ね合わせる工程の手順を説明するための図である。本発明の実施の形態における圧電アクチュエータはこのような工程を経て形成される。

[0034]

まず、トレイ207上の圧電アクチュエータ素子10をエアピンセット208で取り出し、第1の位置決めベース209上に移送する(図12のステップS1209)。

[0035]

第1の位置決めベース209には、圧電アクチュエータ素子10の外形形状と同一形状となった凸状の薄膜載置部209aが設けられている。

[0036]

薄膜載置部209aの上面は平面であり、かつ圧電アクチュエータ素子10を受ける面は、その外周は一回り小さい形状、好ましくは、圧電アクチュエータ素子10と相似形となっている(図15参照)。これにより、接着剤13が第1の位置決めベース209に洩れるのを防止することができる。

[0037]

薄膜載置部209aの上面に移送された圧電アクチュエータ素子10は、図14(b)に示すように精度よく位置決めされた状態にあるとは限らない。そこで、圧電アクチュエータ素子10の位置ずれを補正するために、図14(c)に示すように4方向から位置決めブロック210a,210b,210c,210dを、圧電アクチュエータ素子10の外周部を押し付ける。これらの位置決めブロック210a,210b,210c,210dの動作方向および位置は、圧電アクチュエータ素子10とほぼ同一形状の外形部を有する薄膜載置部209aの側面部209bで規制される。

[0038]

各位置決めブロック210a,210b,210c,210dが薄膜載置部209aの側面部209bに当接することにより圧電アクチュエータ素子10は、第1の位置決めベース209上の所定の位置に位置決めされる(図12のステップS1210)。

[0039]

薄膜載置部209aの上面には、図14(c)の右側にU-U部の断面図を示したように、エアを吸引あるいは噴出する微細な空気孔209cが複数個設けられている。薄膜載置部209aの上面に位置決めされた圧電アクチュエータ素子10は、微細な空気孔209cを通してエアポンプ212で吸引され固定される(図12のステップS1211)。

[0040]

一方、フレクシャ7は、図16に示すように第2の位置決めベース211上に 固定されている(図12のステップS1212)。この状態でフレクシャ7の薄 膜保持部8a,8bには接着剤13が塗布される(図12のステップS1213)。

[0041]

その後、図17に示すように圧電アクチュエータ素子10を吸引した状態の第 1の位置決めベース209は、フレクシャ7を固定した第2の位置決めベース2 11に嵌め合われる。嵌め合いは、第2の位置決めベース211に設けたガイド 軸211aを、第1の位置決めベース209に設けたガイド穴209 dに係合さ せることにより行い、これにより、第1の位置決めベース209,第2の位置決 めベース211は互いに正確に位置決めされて重ねられる(図12のステップS 1214)。

[0042]

このときフレクシャ7と圧電アクチュエータ素子10との間には数μmの隙間 Mが生じるように第1の位置決めベース209と第2の位置決めベース211と は構成されている。これにより圧電アクチュエータ素子10を薄膜載置部209 a に押し付けて破損させないように配慮している。

[0043]

そして、図17(b)に示すように第1の位置決めベース209と第2の位置 決めベース211とが重ね合わされて圧電アクチュエータ素子10とフレクシャ 7が対向した状態となったところで、薄膜載置部209aの空気孔209cから 逆にエアを噴出させる(図12のステップS1215)。これにより、圧電アク チュエータ素子10は、フレクシャ7の薄膜保持部8a,8bに確実に接着され る。接着剤13の硬化のために加熱を行うが、その間も薄膜載置部209aの空 気穴209cからエアを噴出し続ける(図12のステップS1216)。

[0044]

続いて、上述の製造工程を経て形成した圧電アクチュエータ素子を備えるディスク装置におけるヘッド支持機構100の動作について、図18~図20を参照して説明する。図18はヘッド支持機構100の側面図であり、図19はヘッド

支持機構100の動作を説明するための圧電アクチュエータ素子10の断面および電圧印加仕様を説明するための図である。図20はヘッド支持機構100の動作を説明するための概略構成平面図である。

[0045]

圧電アクチュエータ素子10の薄膜圧電体素子駆動配線9cは図19(a)に示すようにグランドレベルに設定されている。薄膜圧電体素子駆動配線9a,9bには図19(b),(c)に示すようにそれぞれ第1の薄膜圧電体11a,第2の薄膜圧電体11bをそれぞれ駆動する駆動電圧が印加される。この駆動電圧は、バイアス電圧V₀を中心としてお互いに逆位相となっている。駆動電圧が印加されると、図19(a)に示すように第1の薄膜圧電体11a,第2の薄膜圧電体11bは矢印B方向に収縮する。第1の薄膜圧電体11a,第2の薄膜圧電体11bには図10(c)に矢印で示す分極方向Pの方向に電圧が印加されるため、第1の薄膜圧電体11a,第2の薄膜圧電体11bの分極が反転しその特性を損なうことはない。また、印加電圧が分極を反転させない程度に小さい場合、特性を損なうおそれがないので、薄膜圧電体素子駆動配線9a,9bにはプラス・マイナスいずれの電圧を印加しても構わない。

[0046]

図20は第2の圧電体素子ユニット10bが伸び、第1の圧電体素子ユニット10aが収縮したときのスライダ2の回転動作について描いた図であり、第2の圧電体素子ユニット10bが矢印E方向に伸び、第1の圧電体素子ユニット10aが矢印D方向に収縮すると、スライダ2およびスライダ保持基板3aは突起部3bに当接するディンプル4gを中心に矢印C方向に回動する。したがって、スライダ2上に設けられた磁気ヘッド1は、磁気ディスクに同心状態で設けられた各トラックの幅方向に移動することになる。これによりトラックから位置ずれを起こした磁気ヘッド1を所定のトラックに追従させることができ、磁気ヘッド1のオントラック性を高精度で実現することができる。また、第1の圧電体素子ユニット10aと第2の圧電体素子ユニット10bとを連結している第2の連結部14bは柔らかいコーティング樹脂14で形成されており圧電アクチュエータ素子10の変形を阻害しない。さらに、第1の連結部14aと第2の連結部14b

の間にスリット10 c が形成されているため連結部の柔軟性を増している。

[0047]

繋ぎ部19a,19bの幅寸法は、図4に示すように、配線6a,6b,6c,6dが、それぞれ配置される必要最小限の幅寸法にそれぞれなっているために、スライダ保持基板3aの回動時における繋ぎ部19a,19bの弾性変形による負荷が低減されて、スライダ保持基板3aが確実に回動される。

[0048]

なお、スライダ2には、図2に示すロードビーム4の板バネ部4eにより20 mN~30mNの大きさのロード荷重が加えられており、スライダ保持基板3 a が回動される場合には、このロード荷重が、ディンプル4gとスライダ保持基板3 a とに作用する。したがって、スライダ保持基板3 a には、スライダ保持基板3 a とディンプル4gとの摩擦係数にて決定される摩擦力が作用する。この摩擦力によりスライダ保持基板3 a の突起部3 b とディンプル4gとの間に位置ずれが生じない。

[0049]

図20(b)は、図20(a)の構成の模式図を示したものである。なお、連結部14bは、基本動作に影響しないので、図20(b)には記載していない。 薄膜保持部8aと第1の圧電体素子ユニット10aとからなる第1のビーム161と薄膜保持部8bおよび第2の圧電体素子ユニット10bとからなる第2のビーム162とは、ディンプル4gで回動自在に拘束されたスライダ保持基板3aに回動自在に連結されている。磁気ヘッド1はディンプル4gから距離dを置いてスライダ保持基板3a上に設けられている。繋ぎ部19a,19bは、スライダ2のロール方向およびピッチ方向に柔軟な構成となっているため、スライダ2がディスク上に浮上特性に対して良好な特性を与える。第1のビーム161と第2のビーム162とがそれぞれD方向,E方向に伸縮するとスライダ保持基板3aが回動し、磁気ヘッド1はトラックに対して垂直方向に移動する。

[0050]

【発明の効果】

以上説明したように本発明の実施の形態における圧電アクチュエータは、第1

の圧電体素子ユニットと第2の圧電体素子ユニットとが、フレクシャ側の基部の連結部と、その反対側にある第1および第2の圧電体素子ユニットそれぞれの先端付近の連結部の2箇所で樹脂等により結合されているので薄膜を高精度に、かつ破損させずにフレクシャに貼り付けることができる。また、これにより圧電素子駆動用の昇圧電源回路などを必要とするようなことがなく、ヘッド素子は磁気ディスク上に沿って、微小な範囲で変位可能となり、したがって、ヘッド素子を磁気ディスク上の任意の位置にて高精度で位置決めすることができるヘッド支持機構が得られることとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構の斜視図

【図2】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構を分解して示す斜視図

【図3】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構に使用されるスライダの斜視図

【図4】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構に使用されるフレクシャの構成を 示す分解斜視図

【図5】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構が備える圧電アクチュエータ素子 の平面図

【図6】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構備える圧電アクチュエータ素子の断面図

【図7】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構に使用されるフレクシャの平面図 【図8】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構に使用されるフレクシャのX-X 線部断面図 【図9】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構に使用されるフレクシャのY-Y 線部断面図

【図10】

(a)~(c)は本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構が備える圧電アクチュエータ素子およびその電極を成膜する手順を示す拡大断面図

【図11】

(a)~(g)は本発明の実施の形態において単結晶MgO基板上に成膜した 薄膜圧電体を2層構造化する手順を示す拡大断面図

【図12】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構が備える圧電アクチュエータ素子の製造方法を示すフローチャート

【図13】

(a)~(d)は本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構が備える圧電アクチュエータ素子の第2の単結晶MgO基板の除去工程を説明する図

【図14】

(a)~(c)は本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構が備える圧電アクチュエータ素子を第1の位置決めベース上に位置決めする工程を説明する図

【図15】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構が備える圧電アクチュエータ素子 を位置決めするための第1の位置決めベースの斜視図

【図16】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構が備える圧電アクチュエータ素子 を位置決めするための第2の位置決めベースの斜視図

【図17】

(a),(b)は本発明の実施の形態において圧電アクチュエータ素子を位置 決めするとき、第2の位置決めベースを第1の位置決めベース上に重ねる工程を 説明する図

【図18】

本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構の部分側面図

【図19】

- (a)~(c)は本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構の動作を説明するための圧電アクチュエータ素子の断面図および電圧印加仕様を説明する図 【図20】
- (a) は本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構の動作を説明するための 概略構成平面図
- (b)は本発明の実施の形態におけるヘッド支持機構の動作を説明するための 模式図

【図21】

- 一般的なディスク装置に備えられるヘッド支持機構の構成の一例を示す平面図 【符号の説明】
- 1 磁気ヘッド(ヘッド素子)
- 2 スライダ
- 3 a スライダ保持基板
- 4 ロードビーム
- 7 フレクシャ
- 8 a, 8 b 薄膜保持部
- 10 圧電アクチュエータ素子
- 10a 第1の圧電体素子ユニット
- 10b 第2の圧電体素子ユニット
- 10c スリット
- 11a 第1の薄膜圧電体
- 11b 第2の薄膜圧電体
- 14 コーティング樹脂
- 14a 第1の連結部
- 14b 第2の連結部
- 209 第1の位置決めベース
- 209a 薄膜載置部

特2002-219346

209b 側面部

209c 空気孔

209 d ガイド穴

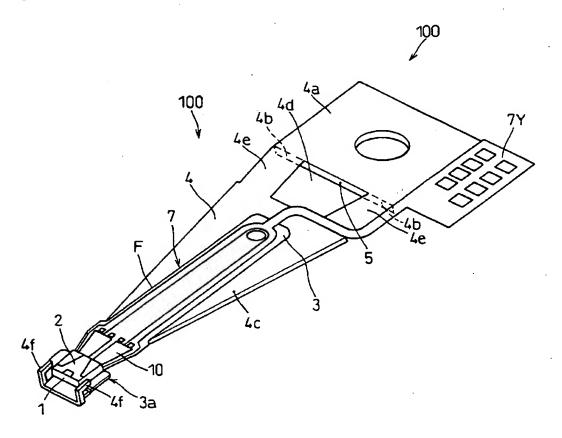
211 第2の位置決めベース

211a ガイド軸

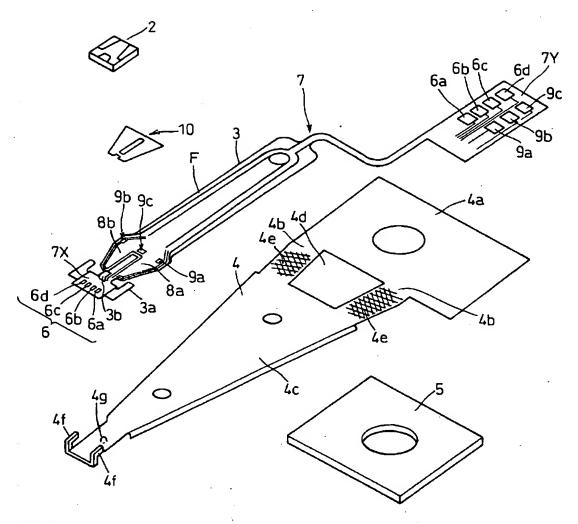
【書類名】

図面

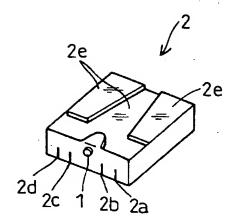
【図1】



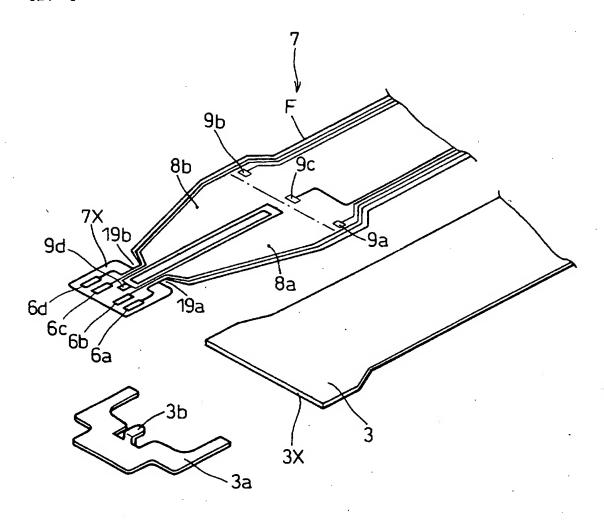
【図2】



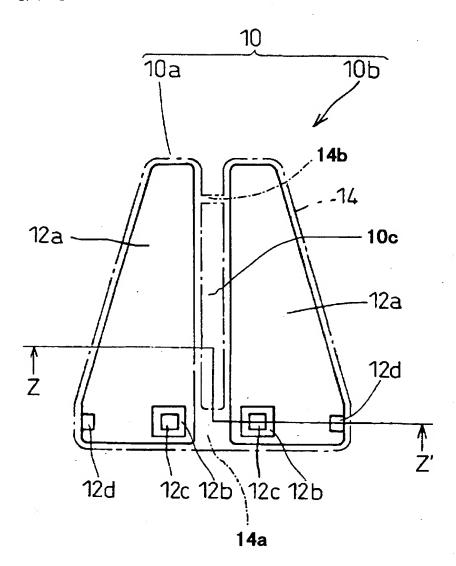
【図3】



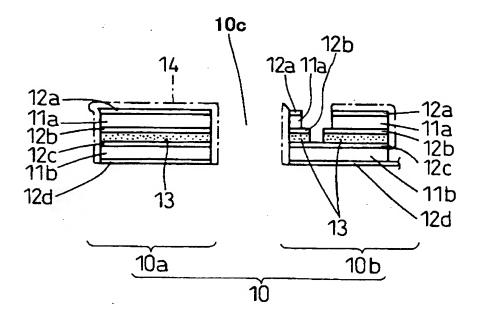
【図4】



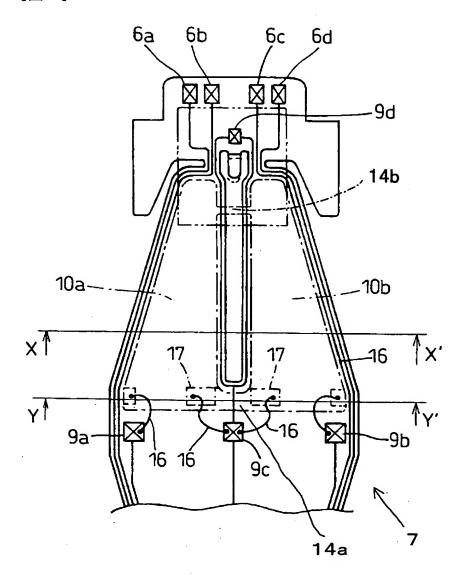
【図5】



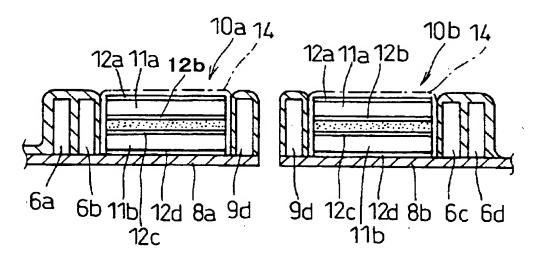
【図6】



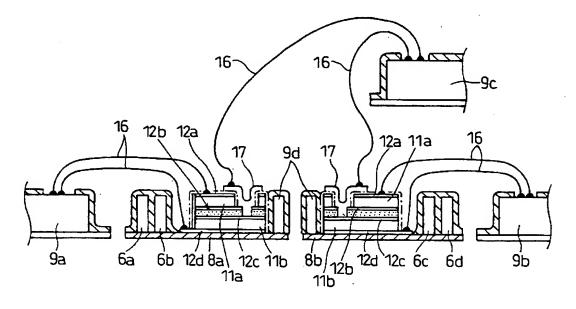
【図7】



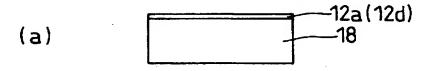
【図8】

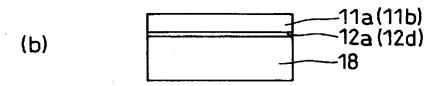


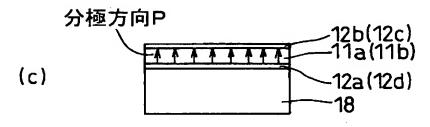
【図9】



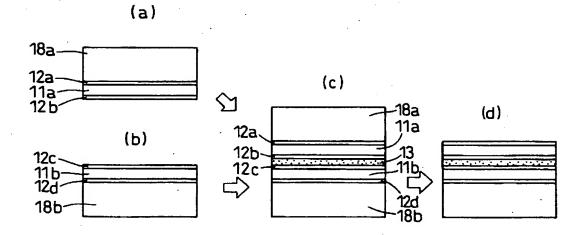
【図10】

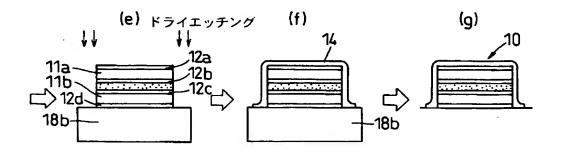




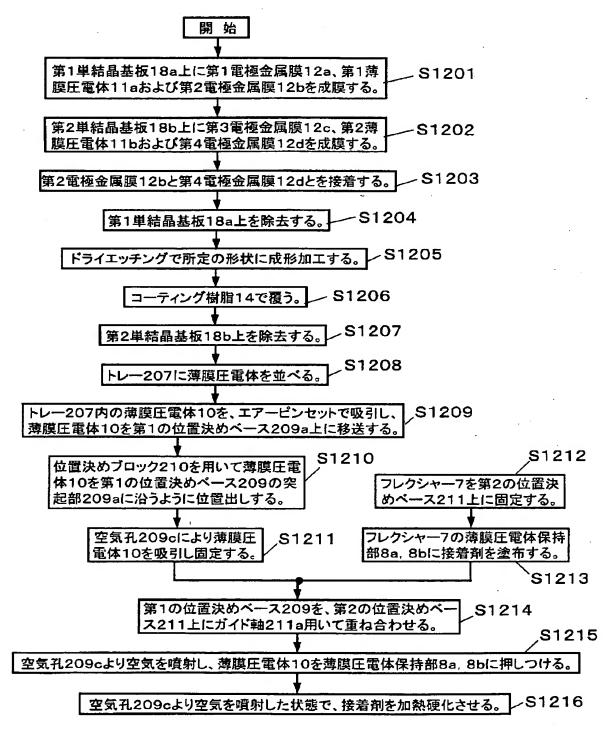


【図11】

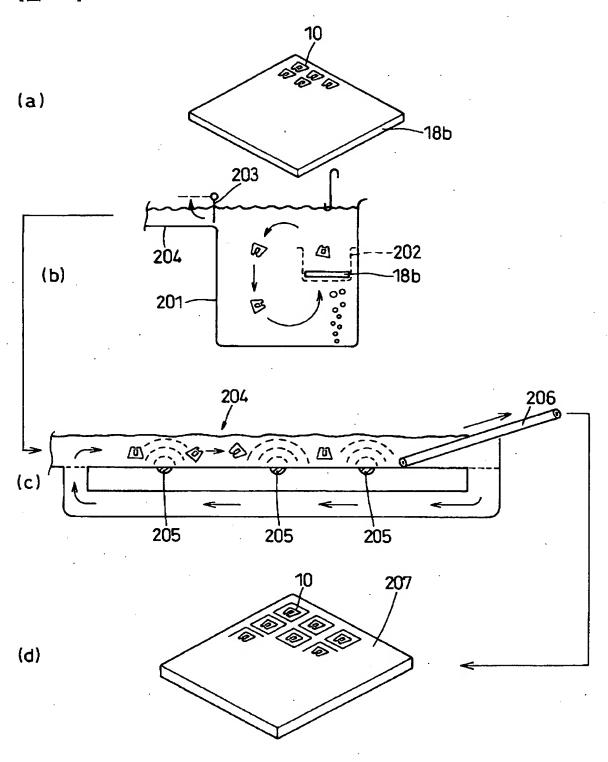




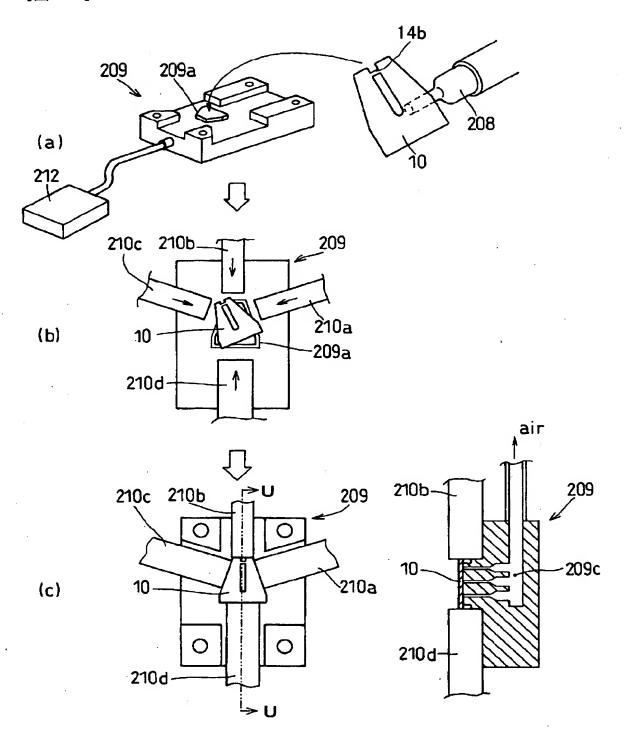
【図12】



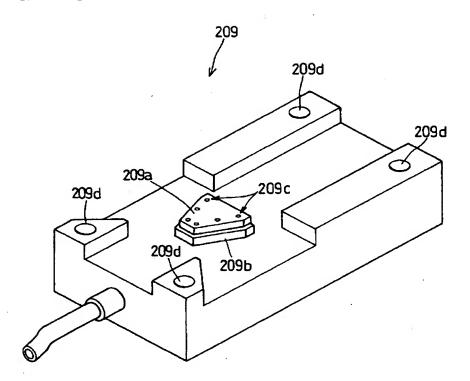




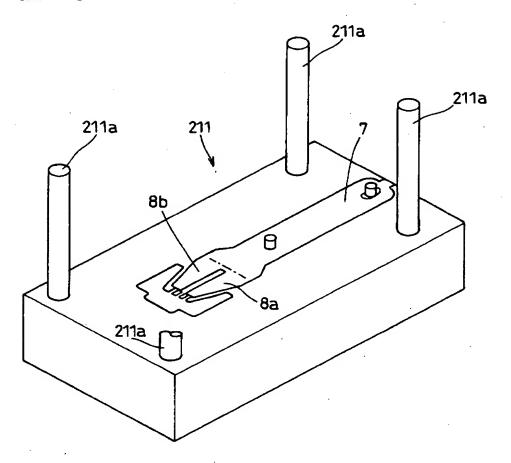
【図14】



【図15】

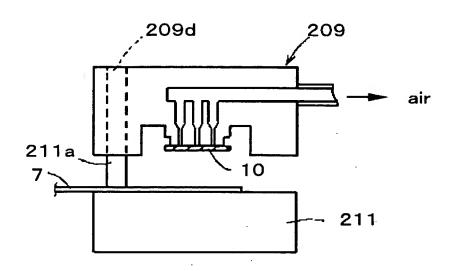


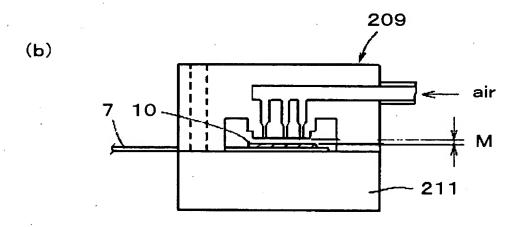
【図16】



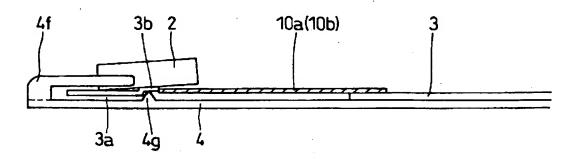
【図17】



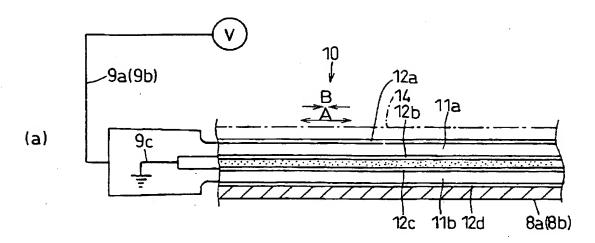


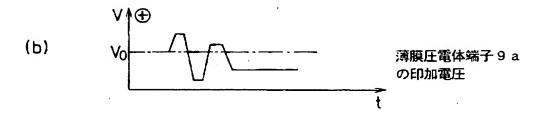


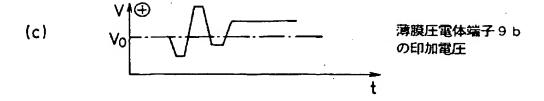
【図18】



【図19】



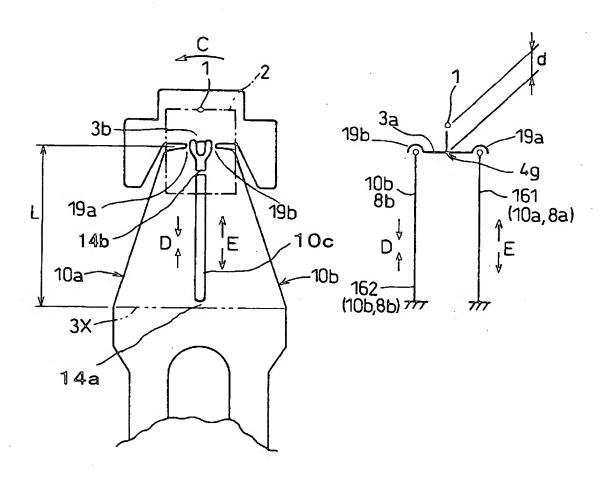


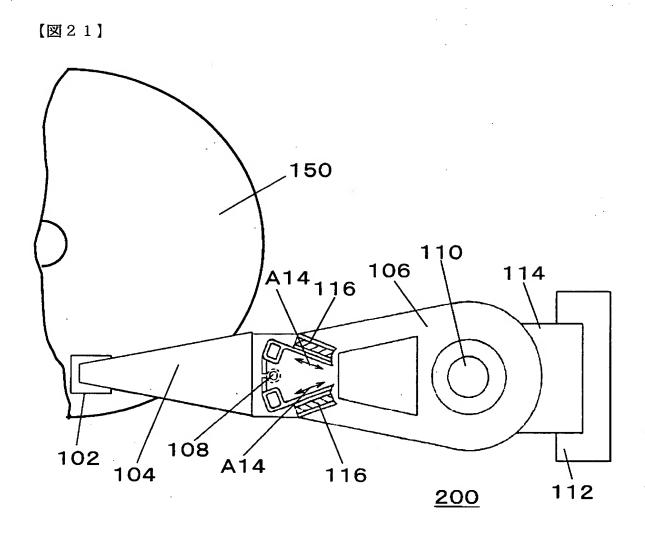




[図20]









【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 組立性に優れ、破損を回避できて、かつ効率的なヘッドの微小変位が可能な圧電アクチュエータとその製造方法およびこれを用いたヘッド支持機構を提供する。

【解決手段】 第1の圧電体素子ユニット10aと、第1の圧電体素子ユニット10aと略並行に位置する第2の圧電体素子ユニット10bと、第1の圧電体素子ユニット10bとを連結する第1の圧電体素子ユニット10bとを連結する第1の連結部14a,第2の連結部14bとを設け、製造工程で第1の圧電体素子ユニット10aおよび第2の圧電体素子ユニット10bが破損しないように、かつそれぞれの圧電体素子ユニットの変位を妨げないようにすることにより、ヘッド位置決め精度の高いヘッド位置決め機構を構成する圧電アクチュエータが得られる。

【選択図】 図5



出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社